

气相化学沉积设备 沈阳鹏程公司 气相化学沉积设备价格

产品名称	气相化学沉积设备 沈阳鹏程公司 气相化学沉积设备价格
公司名称	沈阳鹏程真空技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市沈河区凌云街35号
联系电话	13898863716

产品详情

PCVD工艺的具体流程

PCVD工艺的具体流程如下：

(1)沉积。沉积过程借助低压等离子体使流进高纯度石英玻璃沉积管内的气态卤化物和氧气在1000 以上的高温条件下直接沉积成设计要求的光纤芯中玻璃的组成成分。

(2)熔缩。沿管子方向往返移动的石墨电阻炉对小断旋转的管子加热到大约2200 ，气相化学沉积设备，在表面张力的作用下，分阶段将沉积好的石英管熔缩成一根实心棒(预制棒)。

(3)套棒。为获得光纤芯层与包层材料的适当比例，将熔缩后的石英棒套入一根截面积经过精心挑选的管子中，这样装配后即可进行拉丝。

(4)拉丝。套棒被安装在拉丝塔的顶部，下端缓缓放入约2100 的高温炉中，气相化学沉积设备价格，此端熔化后被拉成所需包层直径的光纤(通常为125 cm)，并进行双层涂覆和紫外固化。

(5)光纤测试。拉出的光纤要经过各种试，以确定光纤的几何、光学和机械性能。

以上就是关于化学气相沉积的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

生产晶须：

晶须属于一种发育的单晶体，它在符合材料范畴中有着很大的作用，能够用于生产一些新型复合材料。化学气相沉积法在生产晶须时使用的是金属卤化物的氢还原性质。化学气相沉积法不但能制备出各类金属晶须，同时也能生产出化合物晶须，气相化学沉积设备厂家，比如氧化铝、金刚砂、碳化钛晶须等等。

想要了解更多沈阳鹏程真空技术有限责任公司的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

化学气相沉积技术类型介绍

想了解更多关于化学气相沉积的相关资讯，请持续关注本公司。

化学气相沉积装置主要的元件就是反应器。按照反应器结构上的差别，我们可以把化学气相沉积技术分成开管/封管气流法两种类型：

1 封管法这种反应方式是将一定量的反应物质和集体放置于反应器的两边，将反应器中抽成真空，再向其中注入部分输运气体，然后再次密封，再控制反应器两端的温度使其有一定差别，它的优点是：能有效避免外部污染；无须持续抽气就能使是内部保持真空。

2 开管法这种制备方法的特点是反应气体混合物能够随时补充。废气也可以及时排出反应装置。以加热方法为区分，开管气流法应分为热壁和冷壁两种。前者的加热会让整个沉积室壁都会因此变热，所以管壁上同样会发生沉积。冷壁式加热一般会使用感应加热、通电加热以及红外加热等等。

气相化学沉积设备-沈阳鹏程公司-气相化学沉积设备价格由沈阳鹏程真空技术有限责任公司提供。沈阳鹏程真空技术有限责任公司为客户提供“电阻热蒸发镀膜，磁控溅射，激光脉冲沉积，电子束”等业务，公司拥有“鹏程真空”等品牌，专注于成型设备等行业。，在沈阳市沈河区凌云街35号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：董顺。